

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成21年2月12日(2009.2.12)

【公開番号】特開2008-178873(P2008-178873A)

【公開日】平成20年8月7日(2008.8.7)

【年通号数】公開・登録公報2008-031

【出願番号】特願2007-341323(P2007-341323)

【国際特許分類】

B 0 1 J	31/14	(2006.01)
C 0 8 F	6/06	(2006.01)
C 0 8 F	4/78	(2006.01)
C 0 7 C	2/26	(2006.01)
C 0 7 C	11/107	(2006.01)
C 0 7 C	11/02	(2006.01)
C 0 7 C	7/04	(2006.01)
C 0 7 B	61/00	(2006.01)

【F I】

B 0 1 J	31/14	Z
C 0 8 F	6/06	
C 0 8 F	4/78	
C 0 7 C	2/26	
C 0 7 C	11/107	
C 0 7 C	11/02	
C 0 7 C	7/04	
C 0 7 B	61/00	3 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成20年12月22日(2008.12.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

クロム系触媒を用いるエチレン低重合体の製造方法であって、クロム系触媒の存在下、溶媒中でエチレンの低重合反応を行い、当該エチレンの低重合反応により得られた反応液から、エチレン低重合体を分離してデセン、テトラデセン、副生ポリマー及び触媒成分を含む溶液を得、下記一般式(1)の条件下で、蒸発分離器により、デセン及びテトラデセンを含む前記溶液からデセンを分離回収することを特徴とするエチレン低重合体の製造方法。

【数1】

$$\theta / 1.2 \text{ EXP } (850 / T) \leq 1 \quad (1)$$

(一般式(1)中、Tは、蒸発分離器における残溶液の温度()であり、は、蒸発分離器における残溶液の滞留時間(分)である。)

【請求項2】

前記蒸発分離器により分離されたデセン中に含まれるハロゲン量が、前記蒸発分離器における残溶液に含まれるハロゲン量に対し、分解率 10 % 以下であることを特徴とする請求項 1 に記載のエチレン低重合体の製造方法。

【請求項 3】

前記クロム系触媒は、少なくとも、クロム化合物 (a) と、窒素含有化合物 (b) と、アルミニウム含有化合物 (c) 及びハロゲン含有化合物 (d) と、の組み合わせから構成されることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のエチレン低重合体の製造方法。

【請求項 4】

前記蒸発分離器が、薄膜式蒸発器であることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載のエチレン低重合体の製造方法。

【請求項 5】

前記エチレン低重合体が、1-ヘキセンであることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載のエチレン低重合体の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

本発明者等は、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、本発明を達成するに至った。かくして本発明によれば、クロム系触媒を用いるエチレン低重合体の製造方法であって、クロム系触媒の存在下、溶媒中でエチレンの低重合反応を行い、エチレンの低重合反応により得られた反応液から、エチレン低重合体を分離してデセン、テトラデセン、副生ポリマー及び触媒成分を含む溶液を得、下記一般式 (1) の条件下で、蒸発分離器により、デセン及びテトラデセンを含む溶液からデセンを分離回収することを特徴とするエチレン低重合体の製造方法が提供される。